(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-269263

(43)公開日 平成11年(1999)10月5日

識別記 号		Fl				
		C08G 65/2	34			
		65/3	2			, ·
		CO8L 71/0	0		A	
					Y	
		HO1B 1/1	2		Z	
	審査請求	未請求 請求	対項の数28	OL	(全14頁)	最終頁に続く
特願平10-75409		(71)出願人	00010899	93		
			ダイソー	株式会	社	
平成10年(1998) 3月24日		大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号			厂目10番8号	
		(72)発明者	三浦 克	人		
			兵庫県尼	崎市大	高洲町9番地	也 ダイソー株
			式会社内	l		
		(72)発明者	柳田 政	徳		
			兵庫県尼	崎市大	高洲町9番均	也 ダイソー株
			式会社内	Ī		
		(72)発明者	肥後橋	弘喜		
			兵庫県尼	崎市大	高洲町9番均	也 ダイソー株
						•
		(74)代理人			英 (外1名	4)
						最終頁に続く
		職別記号 審査請求 特願平10-75409	職別記号 F 1	職別記号 F 1	職別記号 F 1 C08G 65/24 65/32 C08L 71/00 H01B 1/12 審査請求 未請求 請求項の数28 O L 特願平10-75409 (71)出願人 000108993 ダイソー株式会・ 大阪府大阪市西 (72)発明者 三浦 克人 兵庫県尼崎市大 式会社内 (72)発明者 柳田 政徳 兵庫県尼崎市大 式会社内 (72)発明者 肥後橋 弘喜 兵庫県尼崎市大 式会社内	職別記号 F 1 C086 65/24 65/32 C08L 71/00 A Y H01B 1/12 Z 審査請求 未請求 請求項の数28 O L (全14頁) 特願平10-75409 (71)出願人 000108993 ダイソー株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1つ(72)発明者 三浦 克人 兵庫県尼崎市大高洲町 9番封 式会社内 (72)発明者 柳田 政徳 兵庫県尼崎市大高洲町 9番封 式会社内 (72)発明者 肥後橋 弘喜 兵庫県尼崎市大高洲町 9番封

(54) 【発明の名称】ポリエーテル共重合体および架橋高分子固体電解質

(57)【要約】

【課題】 加工性、成形性、機械的強度、柔軟性や耐熱性などに優れており、かつそのイオン伝導性は著しく改善されている架橋高分子固体電解質を得る。

【解決手段】 エピクロロヒドリンから誘導される繰り返し単位 $5\sim4$ 0 モル%、エチレンオキシドから誘導される繰り返し単位 95 ~6 0 モル%、更に架橋が可能な反応性オキシラン化合物から誘導される繰り返し単位 $0.001\sim15$ モル%を有してなり、重量平均分子量が $10'\sim10'$ の範囲内であるポリエーテル共重合体を用いる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 式(I):

【化1】

で示される単量体から誘導される繰り返し単位4~40 モル%、 (B)式(II):

【化2】

で示される単量体から誘導される繰り返し単位95~5 9モル%、および (C) 架橋成分として、式 (III-1) または式(III-2):

【化3】

【化4】

[式中、R'およびR'は、エチレン性不飽和基を含有す る置換基、反応性ケイ素基を含有する置換基または式 (IV):

【化5】

$$--R^3CH-CH_2 \qquad (IV)$$

で示される末端にエポキシ基を含有する置換基(R'は 炭素、酸素、および水素原子から選ばれた原子から成る 二価の有機残基である。)である。〕で示される単量体 から誘導される繰り返し単位0.001~15モル%を 有してなり、重量平均分子量が10'~10'の範囲内で あるポリエーテル共重合体。

【請求項2】 重量平均分子量が10°~5×10°の範 囲内である請求項1に記載のポリエーテル共重合体。

【請求項3】 繰り返し単位(A)が9~30モル%、 繰り返し単位(B)が90~69モル%、繰り返し単位 (C) が 0.01~10モル%からなる請求項1に記載 のポリエーテル共重合体。

【請求項4】 繰り返し単位 (C) を形成する単量体 が、アリルグリシジルエーテル、アリルフェニルグリシ ジルエーテル、ビニルグリシジルエーテル、アクリル酸 グリシジル、メタクリル酸グリシジル、ソルビン酸グリ シジル、ケイ皮酸グリシジル、またはクロトン酸グリシ ジルから得られる架橋成分である請求項1~3のいずれ かに記載のポリエーテル共重合体。

【請求項5】 繰り返し単位(C)を形成する単量体 が、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、3-グ 50

リシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、4-(1,2-エポキシ) ブチルトリメトキシシラン、5-(1,2-エポ キシ) ペンチルトリメトキシシラン、2-(3,4-エポキシ シクロヘキシル) エチルトリメトキシシランから選ばれ た化合物である請求項1~3のいずれか記載のポリエー テル共重合体。

【請求項6】 繰り返し単位 (C) を形成する単量体 が、2,3-エポキシプロピル-2',3'-エポキシ-2'-メ チルプロピルエーテル、エチレングリコール-2,3-エ 10 ポキシプロピル-2',3'-エポキシ-2'-メチルプロピル エーテル、2-メチル-1, 2, 3, 4-ジェポキシブタン、2-メチル-1,2,4,5-ジエポキシペンタン、ヒドロキ ノン-2,3-エポキシプロピル-2',3'-エポキシ-2'-メチルプロピルエーテル、カテコール-2,3-エポキシ プロピル-2',3'-エポキシ-2'-メチルプロピルエーテ ルから選ばれた化合物である請求項1~3のいずれかに 記載のポリエーテル共重合体。

【請求項7】 請求項1~3のいずれかに記載のポリエ ーテル共重合体の架橋成分の反応性を利用してなる架橋 20 体。

【請求項8】 請求項4に記載のポリエーテル共重合体 のエチレン性不飽和基の反応性を利用してなる架橋体。

【請求項9】 請求項5に記載のポリエーテル共重合体 の反応性ケイ素基の反応性を利用してなる架橋体。

【請求項10】 請求項6に記載のポリエーテル共重合 体の側鎖エポキシ基の反応性を利用してなる架橋体。

【請求項11】 エチレン性不飽和基の反応性を利用し た架橋が有機過酸化物およびアゾ化合物から選ばれたラ ジカル開始剤による架橋、または紫外線および電子線か ら選ばれた活性エネルギー線による架橋である請求項7 または8に記載の架橋体。

【請求項12】 エチレン性不飽和基の反応性を利用し た架橋が少なくとも2個の水素化ケイ素を有する化合物 とのヒドロシリル化反応による架橋である請求項7また は8に記載の架橋体。

【請求項13】 側鎖エポキシ基の反応性を利用した架 橋がポリアミン類または酸無水物類による架橋である請 求項10に記載の架橋体。

【請求項14】 請求項7に記載のポリエーテル共重合 40 体の架橋モノマー成分の反応性を利用して架橋した架橋 体に、電解質塩化合物を混合して得られる架橋高分子固 体電解質。

【請求項15】 請求項8に記載のポリエーテル共重合 体のエチレン性不飽和基の反応性を利用して架橋した架 橋体に、電解質塩化合物を混合して得られる架橋高分子 固体電解質。

【請求項16】 請求項9に記載のポリエーテル共重合 体の反応性ケイ素基の反応性を利用して架橋した架橋体 に、電解質塩化合物を混合して得られる架橋高分子固体 電解質。

30

【請求項17】 請求項10に記載のポリエーテル共重 合体の側鎖エポキシ基の反応性を利用して架橋した架橋 体に、電解質塩化合物を混合して得られる架橋高分子固 体電解質。

【請求項18】 請求項1~3のいずれかに記載のポリエーテル共重合体および電解質塩化合物の混合物を、該 共重合体の架橋反応性基の反応性を利用して架橋して得 られる架橋高分子固体電解質。

【請求項19】 請求項4に記載のポリエーテル共重合体および電解質塩化合物の混合物を、該共重合体のエチ 10レン性不飽和基の反応性を利用して架橋して得られる架橋高分子固体電解質。

【請求項20】 請求項5に記載のポリエーテル共重合体および電解質塩化合物の混合物を、該共重合体の反応性ケイ素の反応性を利用して架橋して得られる架橋高分子固体電解質。

【請求項21】 請求項6に記載のポリエーテル共重合体および電解質塩化合物の混合物を、該共重合体の側鎖エポキシ基の反応性を利用して架橋して得られる架橋高分子固体電解質。

【請求項22】 電解質塩化合物が金属陽イオン、アンモニウムイオン、アミジニウムイオン、およびグアニジウムイオンから選ばれた陽イオンと、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、テトラフルオロホウ素酸イオン、硝酸イオン、AsF。、PF。、ステアリルスルホン酸イオン、オクチルスルホン酸イオン、ドデシルベンゼンスルホン酸イオン、ドデシルナフタレンスルホン酸イオン、ドデシルナフタレンスルホン酸イオン、ア、7、8、8-テトラシアノーp-キノジメタンイオン、X' SO。、[(X' SO。)(X^2 SO。)(X^2 SO。)(X^2 SO。)(X^2 SO。)(X^2 SO。)(X^2 SO。) に[(X' SO。)(X^2 SO。)から選ばれた陰イオンとからなる化合物である請求項14~21のいずれかに記載の架橋高分子固体電解質。

【請求項23】 X¹、X²、およびX³は各々独立して 炭素数1~6のパーフルオロアルキル基または炭素数6 ~20のパーフルオロアリール基であり、Yがニトロ 基、ニトロソ基、カルボニル基、カルボキシル基、また はシアノ基である請求項22に記載の架橋高分子固体電 40 解質。

【請求項24】 金属陽イオンがLi、Na、K、R b、Cs、Mg、Ca、およびBaから選ばれた金属の 陽イオンである請求項22または23に記載の架橋高分 子固体電解質。

【請求項25】 金属陽イオンが遷移金属の陽イオンである請求項22または23に記載の架橋高分子固体電解

【請求項26】 金属陽イオンがMn、Fe、Co、N i、Cu、Zn、およびAgから選ばれた金属の陽イオ 50 ンである請求項22または23に記載の架橋高分子固体 電解質。

【請求項27】 電解質塩化合物とポリエーテル共重合体の配合割合がモル比(電解質塩化合物のモル数)/ (ポリエーテル共重合体のエーテルの酸素原子の総モル数)の値が0.0001~5である請求項14~26のいずれかに記載の架橋高分子固体電解質。

【請求項28】 請求項14~27のいずれかに記載の 架橋高分子固体電解質を用いた電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は架橋が可能なポリエーテル共重合体、該共重合体の架橋体および架橋された高分子固体電解質に関する。本発明は、特に電池、キャパシター、センサー、コンデンサー、EC(エレクトロクロミック)素子等の電気化学デバイス用材料、ゴムやプラスチック等の帯電防止剤として好適な架橋高分子固体電解質に関する。

[0002]

20

30

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】従来、電池、キャパシター、センサーなどの電気化学デバイスを構成する電解質は、イオン伝導性の点から溶液またはペースト状のものが用いられているが、液漏れによる機器の損傷の恐れがあること、デバイスの実装、加工性に問題があること、また電解液を含浸させるセパレーターを必要とするので、デバイスの超小型化、轉型化に限界があることなどの問題点が指摘されている。これに対し無機結晶性物質、無機ガラス、有機高分子系物質は一般に加工性、成形性に優れ、得られる固体電解質が提案されている。有機高分子系物質は一般に加工性、成形性に優れ、得られる固体電解質が柔軟性、曲げ加工性を有し、応用されるデバイスの設計の自由度が高くなることなどの点からその開発が期待されている。しかしながら、イオン伝導性の面では他の材質より劣っているのが現状である。

【0003】例えばエピクロロヒドリン系ゴムに特定のアルカリ金属塩を含有させてイオン伝導性固体電解質に応用する試みは既に提案されているが(Effect of some factors on conductivities of polymer ionic conductors, Chen Li-quan 他, Wuli Xucb-ao, 36巻 1号60-66頁 (1987))、なお改善されたイオン伝導性が求められていた。エピクロルヒドリン系ゴムと低分子量のポリエチレングリコール誘導体の混合物に特定のアルカリ金属塩を含有させて高分子固体電解質に応用する試みが本出願人を含む特開平2-235957号公報に提案されているが、機械的特性、イオン伝導性ともにより優れたものが求められている。高分子固体電解質を広くデバイスに応用させるにあたっては素子の導通や破損を防ぐため、十分な機械的強度と柔軟性を有することが望まれている。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、エピクロ

ロヒドリンとエチレンオキシドに、更に架橋が可能なオキシラン化合物を組み合わせた共重合体を用いると、架橋する前または後に電解質塩化合物を配合することによって、イオン伝導性に優れ、かつ高温下でも塑性変形または流動性のない固体電解質が得られることを見いだしたものである。

で示される単量体から誘導される繰り返し単位4~40 モル%、(B)式(II):

【化7】

で示される単量体から誘導される繰り返し単位 9 5 ~ 5 9 モル%、および (C) 架橋成分として、式 (III-1) または式 (III-2):

【化8】

$$CH_2$$
- CH - R^1 (III-1)

【化9】

[式中、R¹およびR²は、エチレン性不飽和基を含有する置換基、反応性ケイ素基を含有する置換基または式(IV):

【化10】

$$--R^3CH-CH_2 \qquad \qquad (IV)$$

で示される末端にエポキシ基を含有する置換基 (R³は 炭素、酸素、および水素原子から選ばれた原子から成る 二価の有機残基である。)である。]で示される単量体 から誘導される繰り返し単位 0.001~15 モル%を 有してなり、重量平均分子量が10°~10°の範囲内で あるポリエーテル共重合体を提供する。

【0006】本発明は、(1)該共重合体の反応性を利用して架橋した架橋体、(2)該共重合体(未架橋重合体)に電解質塩化合物を混合して得られる高分子固体電解質、(3)該共重合体の反応性を利用して得られる該共重合体の架橋体と電解質塩化合物からなる架橋高分子固体電解質、および(4)該架橋高分子固体電解質を用いた電池も提供する。

【0007】本発明の共重合体は、(A)式(I)の単 量体から誘導された繰り返し単位:

【化11】

(B)式(II)の単量体から誘導された繰り返し単位:

【化12】

および (C) 式 (III-1) または式 (III-2) 10 の単量体から誘導された繰り返し単位:

【化13】

【化14】

[式中、R¹およびR²は、エチレン性不飽和基を含有す20 る置換基、反応性ケイ素基を含有する置換基または式 (IV):

【化15】

で示される末端にエポキシ基を含有する置換基 (R³は 炭素、酸素、および水素原子から選ばれた原子から成る 二価の有機残基である。)である。]を有する。

【0008】本発明のポリエーテル共重合体を得るため 30 の重合法はエチレンオキサイド部分の開環反応により共 重合体を得る重合法であり、本出願人の特開昭62-1 69823号公報および特開平7-324129号公報 に記載されている。即ち、開環重合用触媒として有機ア ルミニウムを主体とする触媒系、有機亜鉛を主体とする 触媒系、有機錫ーリン酸エステル縮合物触媒系などを用 いて、各モノマーを溶媒の存在下または不存在下、反応 温度10~80℃、撹拌下で反応させることによって得 られる。なかでも、両末端にのみエポキシ基を有するオ キシラン化合物を用いる場合には、有機錫-リン酸エス テル縮合物触媒を用いると置換基即ちメチル基を含まな いエポキシ基のみが重合反応に使われ、メチル基を有す るエポキシ基は全く反応せずにポリマー中に残る。重合 度、あるいは作られる共重合体の性質などの点から、有 機錫一リン酸エステル縮合物触媒系が特に好ましい。

【0009】本発明で架橋体の原料となるポリエーテル 共重合体は、繰り返し単位(A)が4~40モル%、繰 り返し単位(B)が95~59モル%、および繰り返し 単位(C)が0.001~15モル%のものが用いられ る。繰り返し単位(A)5~35モル%、特に9~30 50 モル%、繰り返し単位(B)64~94モル%、特に6

9~90モル%および繰り返し単位 (C) 0.01~10モル%、特に0.1~10モル%が好ましい。

【0010】繰り返し単位(B)が95モル%を越えるとオキシエチレン鎖の結晶化を招き、キャリヤーイオンの拡散移動が低下して、結果的に固体電解質のイオン伝導性を著しく悪化させることとなる。また、繰り返し単位(B)が59モル%よりも少ない場合にはガラス転移温度の上昇を招き、塩の解離能が低下し、イオン伝導度が低下する。

【0011】一般にポリエチレンオキシドの結晶性を低 10 下させることおよびガラス転移温度を下げることにより イオン伝導性が向上することは知られているが、本発明 のポリエーテル共重合体の組成の最適バランスで、イオン伝導性の向上効果は格段に大きいことがわかった。

【0012】一方、架橋モノマー成分(繰り返し単位 (C)を形成する単量体)のモル比が15モル%より大 になるとイオン伝導度は大幅に下がり、また、フイルム にしたときに柔軟性がなくなり、加工性、成形性に問題 が起こる。

【0013】本発明のポリエーテル共重合体はブロック 共重合、ランダム共重合何れの共重合タイプでも良い。 ランダム共重合体の方がよりポリエチレンオキシドの結 晶性を低下させる効果が大きいので好ましい。

【0014】またポリエーテル共重合体の分子量は良好な、加工性、成形性、機械的強度、柔軟性を得るためには重量平均分子量が10'~10'の範囲である。より好ましくは10'~5×10'の範囲内のものが適する。重量平均分子量が10'より小さいと、機械的強度を維持するため、また、高温での流動を防ぐために架橋密度を高くする必要が生じ、得られた電解質のイオン伝導性が30低下する。また10'を越えると加工性、成形性に問題を生ずる。

【0015】繰り返し単位(A)はエピクロロヒドリンから誘導される。繰り返し単位(B)はエチレンオキシドから誘導される。繰り返し単位(C)を形成する単量体は、エチレン性不飽和基を含有するオキシラン化合物または両末端にエポキシ基を含有するオキシラン化合物である。両末端にエポキシ基を含有するオキシラン化合物の場合には、式(III-1)の単量体のR'は、式(IV)で表され、R'は炭素、酸素、および水素原子から選ばれた原子から成る有機残基である。

【0016】エチレン性不飽和基を有する単量体は、式(III-a):

【化16】

[式中、R⁴はエチレン性不飽和を有する基である。] で示されるオキシラン化合物が好ましい。

R

【0017】エチレン性不飽和基を含有するオキシラン 化合物としては、アリルグリシジルエーテル、4-ビニル シクロヘキシルグリシジルエーテル、α-テルピニルグ リシジルエーテル、シクロヘキセニルメチルグリシジル エーテル、p-ビニルベンジルグリシジルエーテル、アリ ルフェニルグリシジルエーテル、ビニルグリシジルエー テル、3,4-エポキシ-1-プテン、3,4-エポキシ-1-ペンテ ン、4,5-エポキシ-2-ペンテン、1,2-エポキシ-5,9-シク ロドデカジエン、3,4-エポキシ-1-ビニルシクロヘキセ ン、1,2-エポキシ-5-シクロオクテン、アクリル酸グリ シジル、メタクリル酸グリシジル、ソルビン酸グリシジ ル、ケイ皮酸グリシジル、クロトン酸グリシジル、グリ シジルー4-ヘキセノエート、1~12個のオキシエチ レン鎖を持つオリゴエチレングリコールグリシジルエー テルアクリレート、1~12個のオキシエチレン鎖を持 つオリゴエチレングリコールグリシジルエーテルメタク リレート、1~12個のオキシエチレン鎖を持つオリゴ エチレングリコールアリルグリシジルエーテルが用いら れる。好ましくは、アリルグリシジルエーテル、アクリ ル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジルがある。

【0018】繰り返し単位 (C) を形成する反応性ケイ 素基を有する単量体は、式 (III-b-1):

【化17】

[式中、R⁵は反応性ケイ素含有基である。] または式(III-b-2):

【化18】

[式中、R⁶は反応性ケイ素含有基である。] で示される反応性ケイ素基を含有するオキシラン化合物であることが好ましい。

【0019】式(III-b-1)で示される反応性ケイ素基を含有するオキシラン化合物は、好ましくは式(III-b-1-1) および式(III-b-1-2)で示される化合物である。

【化19】

$$R'$$
 $CH_2-CH-CH_2-O-(CH_2)_m-Si-R^8$
 R^9
 $(III-b-1-1)$

$$R^7$$
 CH_2 - CH - $(CH_2)_m$ $-Si$ - R^8 (III-b-1-2)

【0020】式(III-b-2)で示される反応性ケイ素基を含有するオキシラン化合物は、好ましくは式(III-b-2-1)で示される化合物である。 【化20】

$$R^7$$
 $CH_2 \cdot CH_{-}(CH_2)_m - \stackrel{.}{S}_{i-}R^8$
 $CH_2 \quad CH_2 \quad R^9$
 $CH_{-}CH$

【0021】式 (III-b-1-1)、式 (III-b-1-2) および式 (III-b-2-1) において R'、R' は各々同一であっても、異なっていても よいが、少なくとも一個がアルコキシ基であり、残りが アルキル基である。 $mは1\sim6$ の整数を表す。

【0022】式(III-b-1-1)で表されるモノマーには、1-グリシドキシメチルトリメトキシシラン、1-グリシドキシメチルメチルジメトキシシラン、2-グリシドキシエチルトリメトキシシラン、2-グリシドキシエチルメチルジメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、4-グリシドキシブチルメチルジメトキシシラン、4-グリシドキシブチルメチルシメトキシシラン、6-グリシドキシへキシルメチルジメトキシシラン、6-グリシドキシへキシルメチルシメトキシシラン、6-グリシドキシへキシルメチルトリメトキシシカン、6-グリシドキシへキシルメチルトリメトキシシラン、6-グリシドキシへキシルメチルトリメトキシシラン、6-グリシドキシへキシルメチルトリメトキシランなどが挙げられる。

【0023】式(III-b-1-2)で表されるモノマーには、3-(1, 2-xポキシ)プロピルトリメトキシシラン、3-(1, 2-xポキシ)プロピルメチルジメトキシシラン、3-(1, 2-xポキシ)プロピルメチルジメトキシシラン、4-(1, 2-xポキシ)ブチルトリメトキシシラン、4-(1, 2-xポキシ)ブチルメチルジメトキシシラン、5-(1, 2-xポキシ)ペンチルトリメトキシシラン、5-(1, 2-xポキシ)ペンチルメチルジメトキシシラン、6-(1, 2-xポキシ)ヘキシルトリメトキシシラン、6-(1, 2-xポキシ)ヘキシルメチルジメトキシシラン、6-(1, 2-xポキシ)ヘキシルメチルジメトキシシランなどが挙げられる。

【0024】式(III-b-2-1)で表されるモノ

マーには、1-(3、4-エポキシシクロヘキシル) メチルトリメトキシシラン、1-(3、4-エポキシシクロヘキシル) メチルメチルジメトキシシラン、2-(3、4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、2-(3、4-エポキシシクロヘキシル) エチルメチルジメトキシシラン、3-(3、4-エポキシシクロヘキシル) プロピルトリメトキシシラン、3-(3、4-エポキシシクロヘキシル) プロピルメチルジメトキシシラン、4-(3、4-エポキシシクロヘキシル) ブチルトリメトキシシラン、4-(3、4-エポキシシカロヘキシル) ブチルトリメトキシシラン、4-(3、4-エポキシシガロヘキシル) ブチルトリメトキシシラン、4-(3、4-エポキシシガロヘキシル) ブチルメチルジメトキシシランなどが挙げられる。

【0025】これらの中で、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、4-(1,2-エポキシ)プチルトリメトキシシラン、5-(1,2-エポキシ)ペンチルトリメトキシシラン、および2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシランが特に好ましい。

【0026】繰り返し単位(C)を形成する両端にエポキシ基を有する単量体は、式(III-c): 【化21】

[式中、R^{1°}は、二価の有機基である。]で示されることが好ましい。R^{1°}は、水素、炭素、酸素から選ばれた元素よりなる有機基であることが好ましい。

【0027】式 (III-c) におけるR¹°基が、 -CH₂-O-(CHA¹-CHA²-O),-CH₂-、-30 (CH₂),-、-CH₂O-Ph-OCH₂-

[式中、A'およびA'は水素またはメチル基であり、Phはフェニレン基であり、Pは $0\sim12$ の数である。] であることが好ましい。

【0028】両末端にエポキシ基を有する単量体は、次式(III-c-1)、(III-c-2)および(III-c-3)で示される化合物であることが好ましい。

【化22】

(III-c-1)

(III-c-2)

上記(III-c-1)、(III-c-2) および (III-c-3) において、A'、A'は水素原子また

【0029】式(III-c-1)で表されるモノマー には、2,3-エポキシプロピル-2',3'-エポキシ-2'-メチルプロピルエーテル、エチレングリコール-2、3~ エポキシプロピル-2',3'-エポキシ-2'-メチルプロピ ルエーテル、およびジエチレングリコール-2,3-エポ キシプロピル-2',3'-エポキシ-2'-メチルプロピルエ ーテルなどが挙げられる。

はメチル基であり、pは0~12の数を表す。

【0030】式(111-c-2)で表されるモノマー には、2-メチル-1,2,3,4-ジェポキシブタン、2-メチル-1,2,4,5-ジエポキシペンタン、および2-メ チル-1,2,5,6-ジエポキシヘキサンなどが挙げられ る。

【0031】式(III-c-3)で表されるモノマー には、ヒドロキノン-2,3-エポキシプロピル-2',3'-エポキシ-2'-メチルプロピルエーテル、およびカテュ ール-2,3-エポキシプロピル-2',3'-エポキシ-2'-メチルプロピルエーテルなどが挙げられる。

【0032】その中でも2,3-エポキシプロピル-2'、 3'-エポキシ-2'-メチルプロピルエーテル、およびエ チレングリコール-2,3-エポキシプロピル-2',3'-エ ポキシ-2'-メチルプロピルエーテルが特に好ましい。

【0033】本発明において用いられるエチレン件不飽 和基を有する共重合体の架橋方法としては、有機過酸化 物、アゾ化合物等から選ばれるラジカル開始剤、紫外 線、電子線等の活性エネルギー線が用いられる。更に は、水素化ケイ素を有する架橋剤を用いる事もできる。

【0034】有機過酸化物としては、ケトンパーオキサ イド、パーオキシケタール、ハイドロパーオキサイド、 ジアルキルパーオキサイド、ジアシルパーオキサイド、

(III-c-3)

ものが用いられ、これらを列挙すれば、メチルエチルケ トンパーオキサイド、シクロヘキサノンパーオキサイ ド、1,1-ビス(t-プチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチル シクロヘキサン、2,2-ビス(t-ブチルパーオキシ)オクタ ン、n-ブチル-4, 4-ビス(t-ブチルパーオキシ)バレレー ト、t-ブチルハイドロパーオキサイド、クメンハイドロ パーオキサイド、2,5-ジメチルヘキサン-2,5-ジハイド ロパーオキサイド、ジ-t-ブチルパーオキサイド、t-ブ チルクミルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、 α, α'-ビス(t-ブチルパーオキシ-m-イソプロピル)ベン ゼン、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)へキ サン、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)へキ サン、ベンゾイルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシ イソプロピルカーボネート等が挙げられる。その添加量 は有機過酸化物の種類により異なるが、通常、組成物全 体の0.1~10重量%の範囲内である。

【0035】アン化合物としてはアソニトリル化合物、 アゾアミド化合物、アゾアミジン化合物等、通常架橋用 途に使用されているものが用いられ、これらを列挙すれ ば、2,2'-アゾビスイソブチロニトリル、2,2'-アゾビス (2-メチルプチロニトリル)、2,2'-アゾビス(4-メトキシ -2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2,2'-アゾビス(2,4-ジ メチルバレロニトリル)、1,1'-アゾビス(シクロヘキサ ン-1-カルボニトリル)、2-(カルバモイルアゾ)イソブチ ロニトリル、2-フェニルアゾ-4-メトキシ-2,4-ジメチル -バレロニトリル、2,2'-アゾビス(2-メチル-N-フェニ ルプロピオンアミジン)二塩酸塩、2,2'-アゾビス[N-(4 -クロロフェニル)-2-メチルプロピオンアミジン)二塩酸 塩、2,2'-アゾビス[N-ヒドロキシフェニル)-2-メチル プロピオンアミジン]二塩酸塩、2,2'-アゾビス[2-メチ ル-N-(フェニルメチル)プロピオンアミジン]二塩酸塩、 2,2'-アゾビス[2-メチル-N-(2-プロペニル) プロピオ パーオキシエステル等、通常架橋用途に使用されている 50 ンアミジン]二塩酸塩、2,2'-アゾビス(2-メチルプロピ

オンアミジン)二塩酸塩、2,2'-アゾビス[N-(2-ヒドロ キシエチル)-2-メチルプロピオンアミジン]二塩酸塩、 2,2'-アゾビス[2-(5-メチル-2-イミダゾリン-2-イル) プロパン]二塩酸塩、2,2'-アゾビス[2-(2-イミダゾリン -2-イル) プロパン]二塩酸塩、2,2'-アゾビス[2-(4,5, 6,7-テトラヒドロ-1H-1,3-ジアゼピン-2-イル)プロパ ン]二塩酸塩、2,2'-アゾビス[2-(3,4,5,6-テトラヒド ロピリミジン-2-イル)プロパン]二塩酸塩、2,2'-アゾビ ス[2-(5-ヒドロキシ-3, 4, 5, 6-テトラヒドロピリミジン-ヒドロキシエチル)-2-イミダゾリン-2-イル]プロパン} 二塩酸塩、2,2'-アゾビス[2-(2-イミダゾリン-2-イル) プロパン]、2,2'-アゾビス {2-メチル-N-[1,1-ピス(ヒ ドロキシメチル)-2-ヒドロキシエチル]プロピオンアミ ド 、2,2'-アゾビス {2-メチル-N-[1,1-ビス (ヒド ロキシメチル) エチル]プロピオンアミド}、2,2'-アゾ ビス[2-メチル-N-(2-ヒドロキシエチル)プロピオンア ミド]、2,2'-アゾビス(2-メチルプロピオンアミド)ジ ハイドレート、2,2'-アゾビス(2,4,4-トリメチルペンタ ン)、2,2'-アゾビス(2-メチルプロパン)、ジメチル2、 2'-アゾビスイソブチレート、4,4'-アゾビス(4-シアノ 吉草酸)、2,2'-アゾビス[2-(ヒドロキシメチル)プロピ オニトリル]等が挙げられる。その添加量はアゾ化合物 の種類により異なるが、通常、組成物全体の0.1~1 0重量%の範囲内である。

【0036】紫外線等の活性エネルギー線照射による架 橋に適するモノマーは、アクリル酸グリシジルエーテ ル、メタクリル酸グリシジルエーテル、ケイ皮酸グリシ ジルエーテルが特に好ましい。

【0037】また、増感助剤としてジエトキシアセトフ 30 ェノン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1 -オン、ベンジルジメチルケタール、1-(4-イソプロピル フェニル)-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン、4-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル-(2-ヒドロキシ-2-プ ロピル)ケトン、2,2-ジメトキシ-1,2-ジフェニルエタン -1-オン、1-ヒドロキシシクロヘキシルーフェニルケト ン、2-メチル-2-モルホリノ(4-チオメチルフェニル)プ ロパン-1-オン等のアセトフェノン類、ベンゾイン、ベ ンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、 ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチ 40 ルエーテル等のベンゾインエーテル類、ベンゾフェノ ン、o-ベンゾイル安息香酸メチル、4-フェニルベンゾフ ェノン、ヒドロキシベンゾフェノン、4-ベンソイル-4'-メチルージフェニルサルファイド、アルキル化ベンゾフ ェノン、3,3',4,4'-テトラ (t-ブチルパーオキシカルボ ニル)ベンソフェノン、4-ベンソイル-N、N-ジメチル-N-[2-(1-オキソ-2-プロペニルオキシ)エチル]ベンゼン メタナミニウムブロミド、(4-ベンゾイルベンジル)トリ メチルアンモニウムクロイド等のベンゾフェノン類、2-イソプロピルチオキサントン、2,4-ジメチルチオキサン 50

トン、2,4-ジエチルチオキサントン、2,4-ジクロロチオ キサントン等のチオキサントン類、アジドピレン、3-ス ルホニルアジド安息香酸、4-スルホニルアジド安息香 酸、2,6-ビス(4'-アジドベンザル) シクロヘキサノン-2,2'-ジスルホン酸(ナトリウム塩)、p-アジドベンズ アルデヒド、p-アジドアセトフェノン、p-アジドベンソ イン酸、p-アジドベンザルアセトフェノン、p-アジドベ ンザルアセトン、4.4'-ジアジドカルコン、1.3-ビス(4' -アジドベンザル)アセトン、2,6-ビス(4'-アジドベンザ 2-イル) プロパン]二塩酸塩、2,2'-アゾビス {2-[1-(2- 10 ル)シクロヘキサノン、2,6-ビス(4-アジドベンザル)4-メチルシクロヘキサノン、4,4'-ジアジドスチルベン-2, 2'-ジスルホン酸、1,3-ビス(4'-アジドベンザル)-2-プ ロパノン-2'-スルホン酸、1,3-ビス(4'-アジドシンナシ リデン)-2-プロパノン等のアジド類等を任意に用いるこ とができる。

> 【0038】これらの架橋反応の架橋助剤としてエチレ ングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジ アクリレート、トリエチレングリコールジアクリレー ト、ポリエチレングリコールジアクリレート、エチレン 20 グリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジ メタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレ ート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、オリ ゴエチレングリコールジアクリレート、オリゴエチレン グリコールジメタクリレート、プロピレングリコールジ アクリレート、プロピレングリコールジメタクリレー ト、オリゴプロピレングリコールジアクリレート、オリ ゴプロピレングリコールジメタクリレート、1,3-ブチレ ングリコールジアクリレート、1,4-プチレングリコール ジアクリレート、1,3-グリセロールジメタクリレート、 1,1,1-トリメチロールプロパンジメタクリレート、1,1, 1-トリメチロールエタンジアクリレート、ペンタエリス リトールトリメタクリレート、1,2,6-ヘキサントリアク リレート、ソルビトールペンタメタクリレート、メチレ ンビスアクリルアミド、メチレンビスメタクリルアミド ジビニルベンゼン、ビニルメタクリレート、ビニルクロ トネート、ビニルアクリレート、ビニルアセチレン、ト リビニルベンゼン、トリアリルシアニルスルフィド、ジ ビニルエーテル、ジビニルスルホエーテル、ジアリルフ タレート、グリセロールトリビニルエーテル、アリルメ タリクレート、アリルアクレート、ジアリルマレート、 ジアリルフマレート、ジアリルイタコネート、メチルメ タクリレート、ブチルアクリレート、エチルアクリレー ト、2-エチルヘキシルアクリレート、ラウリルメタク リレート、エチレングリコールアクリレート、トリアリ ルイソシアヌレート、マレイミド、フェニルマレイミ ド、N,N'-m-フェニレンビスマレイミド、p-キノンジオ キシム、無水マレイン酸、イタコン酸、等を任意に用い ることができる。

【0039】エチレン性不飽和基を架橋する水素化ケイ 素を有する架橋剤としては、少なくとも2個の水素化ケ

イ素を有する化合物が用いられる。特にポリシロキサン化合物またはポリシラン化合物が良い。ポリシロキサン化合物としては (a-1) 式もしくは (a-2) 式で表される線状ポリシロキサン化合物、または (a-3) 式

で表される環状ポリシロキサン化合物がある。 【0040】 【化23】

(a-3)

【0041】但し、(a-1)式~(a-3)式に於い きるが、
てR''、R''、R''、R''、R''、R''、R''、R''
よびR''は水素原子または炭素数1~12のアルキル基 ト、オクもしくはアルコキシ基を表し、gとrは整数を表す。 r ト等のス
≥2、g≥0、2≤g+ r≤300である。アルキル基 ロピルチ

シ基などの低級アルコキシ基が好ましい。 【0042】ポリシラン化合物としては(b-1)式で表される線状ポリシラン化合物が用いられる。

としては、メチル基、エチル基などの低級アルキル基が

好ましい。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキ

[
$$\text{Hz} 2 4$$
]

 R^{20} H

 R^{21} (S_{1}) S_{2} (S_{1}) R^{24} (b-1)

 R^{22} R^{23}

但し、(b-1) 式に於いて R^{2° 、 R^{2° 、 R^{2° 、 R^{2° は R^{2

【0043】ヒドロシリル化反応の触媒の例としては、パラジウム、白金などの遷移金属あるいはそれらの化合物、錯体が挙げられる。また、過酸化物、アミン、ホスフィンも用いられる。最も一般的な触媒はジクロロビス(アセトニトリル)パラジウム(II)、クロロトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)、塩化白金酸が挙げられる。

【0044】反応性ケイ素基含有の共重合体の架橋方法 としては、反応性ケイ素基と水との反応によって架橋で 50

きるが、反応性を高めるには、ジブチルスズジラウレート、ジブチルスズマレート、ジブチルスズジアセテート、オクチル酸スズ、ジブチルスズアセチルアセトナート等のスズ化合物、テトラブチルチタネート、テトラプロピルチタネート等のチタン化合物、アルミニウムトリスエチルアセトアセテート、ジイソプロポキシアルミニウムエチルアセトアセテート等のアルミニウム化合物などの有機な属化合物、あるいは、ブチルアミン、オクチルアミン、ラウリルアミン、ジブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジェタノールアミン、トリエタノールアミン、ジローントリアミン、ドリエチレンテトラアミン、シクロールアミン、ベンジルアミン、ジエチルアミノプロピルアミン、グアニン、ジフェニルグアニン等のアミン系化合物などを触媒として用いても良い。

【0045】側鎖にエポキシ基含有の共重合体の架橋方法としてはポリアミン類、酸無水物類などが用いられる。ポリアミン類としては、ジエチレントリアミン、ジプロピレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、ジメチルアミノプロピルアミン、ジブチルアミノプロピルアミン、ベキサメチレンジアミン、N-アミノエチルピペラジン、ビス-アミノプロピルピペラジン、トリメチルへキサメチレンジアミン、イソフタル酸ジヒドラジドなどの脂肪族ポリアミン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、ジアミノジフェニルスルホン、m-フェニレンジアミン、2,4-トルイレンジアミン、n-トルイレンジアミン、o-トルイレンジアミン、n-トルイレンジアミン、o-トルイレンジアミン、カートルイレンジアミン、n-トルイレンジアミン、o-トルイレンジアミン、キシリレンジア

る。

18

ミンなどの芳香族ポリアミン等が挙げられる。その添加 量はポリアミンの種類により異なるが、通常、組成物全 体の0.1~10重量%の範囲である。

【0046】酸無水物類としては、無水マレイン酸、無 水ドデセニルコハク酸、無水クロレンデック酸、無水フ タル酸、無水ピロメリット酸、ヘキサヒドロ無水フタル 酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、テトラメチレン 無水マレイン酸、テトラヒドロ無水フタル酸、メチルテ トラヒドロ無水フタル酸、無水トリメリット酸等が挙げ られる。その添加量は酸無水物の種類により異なるが、 通常、組成物全体の0.1~10重量%の範囲である。 これらの架橋には促進剤を用いても良く、ポリアミン類 の架橋反応にはフェノール、クレゾール、レゾルシン、 ピロガロール、ノニルフェノール、2,4,6-トリス (ジメチルアミノメチル)フェノールなどがあり、酸無水 物類の架橋反応にはベンジルジメチルアミン、2,4, 6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール、2-(ジ メチルアミノエチル)フェノール、ジメチルアニリン、 2-エチル-4-メチルイミダゾールなどがある。その添 加量は促進剤により異なるが、通常、架橋剤の0.1~ 10重量%の範囲である。

【0047】本発明において用いられる電解質塩化合物 としては、本発明のポリエーテル共重合体または該共重 合体の架橋体に可溶のものならば何でもよいが、以下に 挙げるものが好ましい。即ち、金属陽イオン、アンモニ ウムイオン、アミジニウムイオン、およびグアニジウム イオンから選ばれた陽イオンと、塩素イオン、臭素イオ ン、ヨウ素イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオ ン、テトラフルオロホウ素酸イオン、硝酸イオン、As F。、PF。、ステアリルスルホン酸イオン、オクチル 30 スルホン酸イオン、ドデシルベンゼンスルホン酸イオ ン、ナフタレンスルホン酸イオン、ドデシルナフタレン スルホン酸イオン、7,7,8,8-テトラシアノ-p- キノジメ $\beta \mathcal{V} / \mathcal{J} \mathcal{V} \setminus \mathcal{X}' \mathcal{S} \mathcal{O}_{2}^{\mathsf{T}} \setminus [(\mathcal{X}' \mathcal{S} \mathcal{O}_{2}) (\mathcal{X}^{2} \mathcal{S} \mathcal{O}_{2}) \mathcal{N}]^{\mathsf{T}} \setminus$ [(X¹SO₂)(X²SO₂)(X³SO₂)C]、および[(X¹S O_{2})($X^{2}SO_{2}$)YC] から選ばれた陰イオンとからなる 化合物が挙げられる。但し、X¹、X²、X³、およびY は電子吸引性基である。更に好ましくはX'、X'、およ びX³は各々独立して炭素数が1から6迄のパーフルオ ロアルキル基またはパーフルオロアリール基であり、Y 40 はニトロ基、ニトロソ基、カルボニル基、カルボキシル 基、またはシアノ基である。R³、R⁴、およびR⁵は各 々同一であっても、異なっていてもよい。

【0048】金属陽イオンとしては遷移金属の陽イオン を用いる事ができる。好ましくはMn、Fe、Co、N i、Cu、ZnおよびAg金属から選ばれた金属の陽イ オンが用いられる。又、Li、Na、K、Rb、Cs、 Mg、CaおよびBa金属から選ばれた金属の陽イオン を用いても好ましい結果が得られる。電解質塩化合物と

【0049】本発明において、上記電解質塩化合物の使 用量はポリエーテル共重合体の主鎖および側鎖を含めた エーテルの酸素原子の総モル数に対する割合、即ちモル 比(電解質塩化合物のモル数)/(ポリエーテル共重合 体のエーテルの酸素原子の総モル数)の値は0.000 1~5、好ましくは0.001~0.5の範囲がよい。こ の値が5を越えると加工性、成形性および得られた固体

電解質の機械的強度や柔軟性が低下し、さらにイオン伝 10 導性も低下する。

【0050】本発明のポリエーテル共重合体、その架橋 体、それ等から得られる架橋高分子固体電解質を使用す る際に難燃性が必要な場合には、通常用いられる方法を 採用できる。即ち臭素化エポキシ化合物、テトラブロム ビスフェノールA、塩素化パラフィン等のハロゲン化 物、三酸化アンチモン、五酸化アンチモン、水酸化アル ミニウム、水酸化マグネシウム、リン酸エステル、ポリ リン酸塩、およびホウ酸亜鉛から選択して有効量を添加 する。

【0051】本発明の架橋高分子固体電解質の製造方法 は特に制約はないが、通常ポリエーテル共重合体と電解 質塩化合物を機械的に混合するか、もしくは溶剤に溶解 させて混合した後、溶剤を除去し、架橋するか、または ポリエーテル共重合体を架橋した後電解質塩化合物を機 械的に混合するか、もしくは溶剤に溶解させて混合した 後溶剤を除去するなどの方法によって製造される。機械 的に混合する手段としては、各種ニーダー類、オープン ロール、押出機などを任意に使用できる。溶剤を使用し て製造する場合は各種極性溶媒、例えばテトラヒドロフ ラン、アセトン、アセトニトリル、ジメチルホルムアミ ド、ジメチルスルホキシド、ジオキサン、メチルエチル ケトン、メチルイソプチルケトン、トルエン、エチレン グリコールジエチルエーテル等が単独、或いは混合して 用いられる。溶液の濃度は特に制限はないが1~50重 量%が好ましい。

【0052】エチレン性不飽和基を有する共重合体を、 ラジカル開始剤を利用して架橋する場合10℃~200 ℃の温度条件下1分~20時間で架橋反応が終了する。 また、紫外線等のエネルギー線を利用する場合、一般に は増感剤が用いられる。通常、10℃~150℃の温度 条件下0.1秒~1時間で架橋反応が終了する。水素化 ケイ素を有する架橋剤では10℃~180℃の温度条件 下10分~10時間で架橋反応が終了する。

【0053】反応性ケイ素基を有する共重合体の架橋反 応に用いられる水の量は、雰囲気中の湿気によっても容 易に起こるので特に制限されない。短時間冷水または温 水浴に通すか、またはスチーム雰囲気にさらす事で架橋 する事もできる。エポキシ基を有する共重合体の架橋反 応にポリアミンまたは酸無水物を利用した場合、10~ して前述の化合物を2種類以上併用することは自由であ 50 200℃の温度の条件下10分~20時間で架橋反応が

終了する。

【0054】本発明で示された共重合体および該共重合 体の架橋体は架橋高分子固体電解質として有用な前駆体 となる。本発明の架橋高分子固体電解質は機械的強度と 柔軟性に優れており、その性質を利用して大面積薄膜形 状の固体電解質が容易に得られる。例えば本発明の架橋 高分子固体電解質を用いた電池の作製が可能である。こ の場合、正極材料としてはリチウムーマンガン複合酸化 物、リチウム-バナジウム複合酸化物、コバルト酸リチ ウム、ニッケル酸リチウム、コバルト置換ニッケル酸リ チウム、ポリアセン、ポリピレン、ポリアニリン、ポリ フェニレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリフェニ レンオキサイド、ポリピロール、ポリフラン、ポリアズ レン等がある。負極材料としてはリチウムがグラファイ トあるいはカーボンの層間に吸蔵された層間化合物、リ チウム金属、リチウムー鉛合金等がある。また高いイオ ン伝導性を利用してアルカリ金属イオン、Cuイオン、 Caイオン、およびMgイオン等の陽イオンのイオン電 極の隔膜としての利用も考えられる。

[0055]

【実施例】以下、本発明の実施例を示す。

製造例 (触媒の製造)

撹拌機、温度計および蒸留装置を備えた3つロフラスコにトリプチル錫クロライド10gおよびトリプチルホスフェート35gを入れ、窒素気流下に撹拌しながら250℃で20分間加熱して留出物を留去させ残留物として固体状の縮合物質を得た。以後これを重合用触媒として使用した。

【0056】ポリエーテル共重合体の元素分析、ヨウ素 価および H NMRスペクトルにより得たモノマー換算 30 組成分析の結果を第1表および第2表に示す。ポリエー テル共重合体の分子量測定にはゲルパーミエーションク ロマトグラフィー測定を行い、標準ポリスチレン換算に より分子量を算出した。ゲルパーミエーションクロマト グラフィー測定は(株)島津製作所の測定装置RID-6A、昭和電工(株)製カラムのショウデックスKD-807、KD-806、KD-806MおよびKD-8 03、および溶媒DMFを用いて60℃で行った。ガラ ス転移温度、融解熱量は理学電気(株)製示差走査熱量 計DSC8230Bを用い、窒素雰囲気中、温度範囲- 40 100~80℃、昇温速度10℃/minで測定した。 導電率 σ の測定は 2 0 ℃、 1 mmH g で 7 2 時間真空乾 燥したフィルムを白金電極ではさみ、電圧 0.5 V、周 波数範囲5Hz~1MHzの交流法を用い、複素インピ ーダンス法により算出した。固体電解質フィルムの柔軟 性は25℃に於いてフィルムを180度に折り曲げた時 の折損の有無により評価した。

【0057】実施例1

内容量1Lのガラス製4つ口フラスコの内部を窒素置換 し、これに触媒として触媒の製造例で得られた縮合物質 50 300mgと水分10ppm以下に調整したアリルグリシジルエーテル11gとエピクロロヒドリン81gおよび溶媒としてnーへキサン500gを仕込み、エチレンオキシド100gはエピクロロヒドリンの重合率をガスクロマトグラフィーで追跡しながら、逐次添加した。重合反応な20℃で20時間行った。重合反応はメタノールで停止した。デカンテーションによりポリマーを取りした後、常圧下40℃で24時間、更に減圧下45℃で10時間乾燥してポリマー185gを得た。この共重合体のガラス転移温度は-32℃、重量平均分子量は130万、融解熱量は29J/gであった。エピクロロヒドリンの成分は塩素の元素分析、アリルグリシジルエーテルの成分はコウ素価の測定により求めた。この重合体のモノマー換算組成分析結果は第1表のとおりである。

【0058】得られた共重合体1g、および架橋剤ジクミルパーオキサイド0.015gをアセトニトリル5m 1に溶解し、モル比(電解質塩化合物のモル数)/(共 重合体のエーテルの酸素原子の総モル数)が0.05となるように過塩素酸リチウムを混合した。この混合液を 20 ポリテトラフルオロエチレン製モールド上にキャストして乾燥した後、窒素雰囲気下150℃、3hr加熱してフィルムを得た。本フィルムの導電率および柔軟性についての測定結果を第1表に示す。

【0059】実施例2

第1表に示すモノマーを用いて実施例1と同様の触媒および操作により共重合を行った。得られたポリエーテル共重合体1g、トリエチレングリコールジメタクリレート0.05g、架橋剤ベンゾイルオキサイド0.015gをアセトニトリル20mlに溶解し、モル比(電解質塩化合物のモル数)/(共重合体のエーテルの酸素原子の総モル数)が0.05となるようにリチウムビストリフルオロメタンスルフォニルイミドを混合した後、窒素雰囲気下100℃、3hr加熱してフィルムを得た。本フィルムの導電率および柔軟性についての測定結果を第1表に示す。

【0060】実施例3

第1表に示すモノマーを用いて実施例1と同様の触媒および操作により共重合を行った。得られたポリエーテル共重合体1g、トリエチレングリコールジアクリレート0.05g、増感剤2,2ージメトキシー1,2ージフェニルエタンー1ーオン0.02gをアセトニトリル5m1に溶解し、モル比(電解質塩化合物のモル数)が0.05となるように過塩素酸リチウムを混合した。この混合液をポリテトラフルオロエチレン製モールド上にキャストして乾燥した後、アルゴン雰囲気下で紫外線(30mW/cm²,360nm)を50℃で10分間照射してフィルムを得た。本フィルムの導電率および柔軟性についての測定結果を第1表に示す。

【0061】実施例4

第1表に示すモノマーを用いて実施例1と同様の触媒お よび操作により共重合を行った。得られたポリエーテル 共重合体1g、触媒ジプチルスズジラウレート5mgを テトラヒドロフラン20mlに溶解し、水 10μlを 加えて15分間撹拌を行った。常圧下で溶媒を除去した 後、60℃で10時間乾燥して架橋体を得た。 得られ た架橋体に過塩素酸リチウム100mgを含むテトラヒ ドロフラン溶液5mlを20時間で含浸させた後、17 0℃、80Kgw/cm²で10分間加熱、加圧し、フィルム を得た。本フィルムの導電率および柔軟性についての測 10 性についての測定結果を第1表に示す。 定結果を第1表に示す。

【0062】実施例5

第1表に示すモノマーを用いて実施例1と同様の触媒お 第1表 共重合体および高分子固体電解質

よび操作により共重合を行った。得られたポリエーテル 共重合体1g、および無水マレイン酸 150mgをア セトニトリル10m1に溶解し、モル比(可溶性電解質 塩化合物のモル数)/(共重合体のエーテルの酸素原子 の総モル数)が0.05となるように過塩素酸リチウム のテトラヒドロフラン溶液を混合した。この混合液をポ リテトラフルオロエチレン製モールド上にキャストして 乾燥した後、150℃、20Kgw/cm'で1時間加熱、加 圧し、フィルムを得た。本フィルムの導電率および柔軟

[0063]

【表1】

		実	施	N .	
	1	2	3	4	5
込みモノマー (モル%)		00	95	00	c c
エチレンオキシド	70	80	85	90	65 28
エピクロロヒドリン	27 . 3	19	13	9. 97	28
アリルグリシジルエーテル	. 3	1	•		
メタクリル酸グリシジル			2	0. 03	
3-グリシドキシブロビルトリメトキシシラン				0. 03	7
2,3-エポキシブロビルー2',3'-エポキシー					4
2'ーメチルプロピルエーテル					
E成共重合体の組成(モル%) エチレンオキシド	72	81	87	92. 3	67
エピクロロヒドリン	12 95	18	11	7. 67	26
アリルグリシジルエーテル	25 3	10	11	7.07	20
メタクリル酸グリシジル	3		2		
スラッツル歌シッシンル 3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン				0. 03	
2,3-エポキシブロビルー2',3'-エポキシー				0.03	7
2'~メチルプロピルエーテル					•
は重合体の重量平均分子量	130 万	190 万	210 75	352 万	76 万
(重合体のガラス転移温度(℃)	-32	-53	-54	-55	-51
電合体の融解熱量(]/g)	29	32	35	49	19
CELL THOMINGS (1) 6/					
体電解質フィルムの柔軟性	折損せず	折損せず	折損せず	折損せず	折損せる
体電解質フィルムの導電率					
(S/cm)					
30°C	2. 2X10 ⁻⁶	3. 1X10 ⁻⁶	1. 8X10 ⁻⁶	8. 7X10 ⁻⁶	1. 5X10 ⁻⁶

【0064】比較例1~4

実施例1と同様の方法で、第2表に示すポリエーテル共 重合体を得た。比較例1および2は、架橋剤を無添加に した以外は実施例1と同様の方法でフィルムの成形を行 った。比較例3は実施例1と同様の方法でフィルム成形

> 共重合体および高分子固体電解質 第2表

を行った。比較例4は実施例4と同様の方法でフィルム 成形を行った。得られた結果を第2表に示す。

[0065]

【表2】

	比 較 例			
. —	1	2	3	4
生成共重合体の組成(モル%) エチレンオキシド	10	100	50	30
エグクロロヒドリン	90	100	48	69. 9
アリルグリシジルエーテル	30	•	2	03.0
3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン				0. 1
生重合体の重平均分子量	59 <i>)</i> 5	420万	92 75	66 万
t重合体のガラス転移温度(℃) t重合体の融解熱量(J/g)	-27 57	-57 179	46 5	-38 28
	51	113	J	,20
日体電解質フィルムの柔軟性	折損する	折損する	折損せず	折損せず
3体電解質フィルムの導電率 (S/cm) 30℃	5. 7X10 ⁻⁶	1. 1X10 ⁻⁷	2. 3X10 ⁻⁷	3.2X10 ⁻⁰

【0066】本発明のポリエーテル共重合体から得られ る架橋高分子固体電解質のイオン導電性および機械的特 50

性が優れていることは比較例と対比して明らかである。 【0067】実施例6

1) 正極の作製

LiCoO. 粉末10g、グラファイト(KS-15)7.5g、実施例1によって得られた共重合体7.5g、ジクミルパーオキサイド0.025g、LiBF.0.65g、アセトニトリル50mlをディスパーを用いて攪拌下で混合してペーストを造った。このペーストをアルミ箔上に塗布後乾燥を行い、アルミ箔上に正極物質を付着させた。次いで窒素置換した温度150℃の乾燥機内で3時間加熱することによって架橋させた。

【0068】2)電池の組立

Li箔(直径16mm、厚さ $80\mu m$) に実施例1または 2で作製した高分子固体電解質膜、さらに上記正極を張り合わせて電池を組立てた。これらの作業は全て乾燥アルゴン雰囲気のグローブボックス内で行った。

3) 充放電試験

温度 50℃、電流密度 0.1 m A²/cm で 4.2 V まで充電し、3.0 V まで放電を行った。実施例 1 および 2 の電解質膜の両方で活物質である Li CoO, 1 g 当たり 1 30 m A h の放電容量を得た。

24

[0069]

【発明の効果】本発明の架橋高分子固体電解質は、加工性、成形性、機械的強度、柔軟性や耐熱性などに優れており、かつそのイオン伝導性は著しく改善されている。 10 したがって固体電池をはじめ、大容量コンデンサー、表示素子、例えばエレクトロクロミックディスプレイなど電子機器への応用、およびプラスチックの帯電防止剤としての応用が期待される。

【手続補正書】

【提出日】平成11年3月18日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正内容】

【0022】式(III-b-1-1)で表されるモノマーには、1-グリシドキシメチルトリメトキシシラン、1-グリシドキシメチルメチルジメトキシシラン、2-グリシドキシエチルメチルジメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、4-グリシドキシブチルメチルジメトキシシラン、4-グリシドキシブチルトリメトキシシラン、6-グリシドキシへキシルメチルジメトキシシラン、6-グリシドキシへキシルトリメトキシシランなどが挙げられる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正内容】

【0036】紫外線等の活性エネルギー線照射による架橋に適するモノマーは、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、ケイ皮酸グリシジルが特に好ましい。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0047

【補正方法】変更

【補正内容】

【0047】本発明において用いられる電解質塩化合物 としては、本発明のポリエーテル共重合体または該共重 合体の架橋体に可溶のものならば何でもよいが、以下に 挙げるものが好ましい。即ち、金属陽イオン、アンモニ ウムイオン、アミジニウムイオン、およびグアニジウム イオンから選ばれた陽イオンと、塩素イオン、臭素イオ ン、ヨウ素イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオ ン、テトラフルオロホウ素酸イオン、硝酸イオン、As F。、PF。、ステアリルスルホン酸イオン、オクチル スルホン酸イオン、ドデシルベンゼンスルホン酸イオ ン、ナフタレンスルホン酸イオン、ドデシルナフタレン スルホン酸イオン、7,7,8,8-テトラシアノ-p- キノジメ $\beta \nu / T + \lambda \nabla X' + \Delta O_2 \nabla X'$ [(X'SO₂)(X'SO₂)(X'SO₂)C] 、および[(X'S O₂)(X²SO₂)YC] から選ばれた陰イオンとからなる 化合物が挙げられる。但し、X'、X'、X'、およびY は電子吸引性基である。更に好ましくはX'、X'、およ びX³は各々独立して炭素数が1から6迄のパーフルオ ロアルキル基またはパーフルオロアリール基であり、Y はニトロ基、ニトロソ基、カルボニル基、カルボキシル 基、またはシアノ基である。X'、X'、およびX'は各 々同一であっても、異なっていてもよい。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6	識別記号	FI		
H01G	9/025	H 0 1 M	6/18	E
	9/028		10/40	. В
H 0 1 M	6/18	H 0 1 G	9/00	301G
	10/40		9/02	3 3 1 H

(72)発明者 中村 誠司

兵庫県尼崎市大高洲町9番地 ダイソー株

式会社内